14. ビリアル限界コイルを用いた小型トカマク装置におけるプラズマに関する研究

1. はじめに

ビリアル限界コイル(VLC)は、トロイダル 磁場コイルと変流器コイルを一体としたヘリカ ル型ハイブリッドコイルである。これを磁場コイ ルとして用いるトカマク装置「等々力2号」にお いて、プラズマの電流制御と位置制御が課題とな る。本装置において、真空容器に流れる渦電流の 影響に加え、VLC が離散的に支持されているた めに、誤差磁場が生じる。また、周回電圧が高い 割にはプラズマ電流が小さいという問題がある。

そこで、本研究では、生成プラズマの性能を改善するためにグロー放電洗浄を行った。また、プ ラズマの位置特性について調べるために、プラズ マ発光分布の計測を行った。

等々力2号の概要

「等々力 2 号」の主要パラメータについて表 1 にまとめている。

表1 等々力2号の装置諸元と計測器 装置

真空容器: 大半径 0.3 m、小半径 0.08 m 磁場コイル:ビリアル限界コイル(VLC) (大半径 0.3 m、小半径 0.14 m) プラズマ水平位置制御用コイル

到達真空度:1.2×10⁻⁴ Pa

<u>計測器</u>	計測対象
ワンターンループ:	周回電圧
	プラズマ位置
磁気プローブ :	プラズマ位置
ロゴスキーコイル:	プラズマ電流
トロイダル磁束ループ:	トロイダル磁場
ダブルプローブ:	グロープラズマの
	電子温度・電子密度
四重極分析器:	ガス分圧
発光分布検出器:	プラズマ位置

図1に等々力2号に用いているビリアル限界 コイルの模式図を示す。青色で1本のヘリカル 巻線を示している。

3. 放電洗浄

本研究では、水素ガスを用いたグロー放電によ

飯尾研究室 02M19050 榎田拓郎



図1 等々力2号に用いている ビリアル限界コイルの模式図

る放電洗浄を行った。また、直流放電とパルス放電 の異なる 2 つの方式による洗浄結果についての比 較を行った。まず、放電用陽極は銅製で、先端には 直径 20mm の円形の銅板が取り付けてあり、真空 容器の垂直ポートに1本設置している。グロー放 電洗浄では洗浄すべき面を陰極とするため、真空 容器が陰極となる。これにより、電場により加速 された水素イオンは真空容器内壁に衝突し、壁に 付着した不純物は気相にたたき出され、排気され る。それぞれの放電方式の回路図を図 2,3 に、放



表 2 放電洗浄条件

放電方式	直流放電	パルス放電
電圧	3 kV, 300 V	2 kV, 400 V
電流	30 mA	500 mA(ピーク)、30 mA(平均)
圧力	0.3 Torr	0.3 Torr
放電時間	12 h	12 h
電子温度	~ 1.5 eV	~ 1.5 eV

電条件を表1に示す。直流放電では、まず電圧3kV でプラズマを生成し、その後電圧300V、電流30 mAで維持する。パルス放電回路は、4つのコンデ ンサが並列に充電され、スイッチがオンすると4 直列で放電するマルクス回路である。パルス放電の 周波数は2kHzであり、高周波放電とは異なる周 波数域で行っている。直流放電と比較するために、 時間平均電流を30mAとした。燃料には水素ガス を用い、圧力0.3Torrでそれぞれ12時間ずつ交互 に行った。

図 4 に放電洗浄中に計測したマススペクトル 例を示す。質量数が18、28、29に大きなピーク が見られる。クラッキングパターンから、18 は H₂O、28,29 はC₂H₄、C₂H₆であり、酸素は主 に水、炭素は炭化水素となって排気されている。 図 5 に水とエチレン/エタンの分圧の時間変化 を示す。縦軸は分圧に比例したイオン電流である。





図 7 パルスグローによる放電洗浄前後の トカマク放電波形

どちらの放電の場合も 360 分を過ぎるとほぼ一 定の値になっている。また、不純物のイオン電流 の減少を比較すると、パルスグローによる結果の 方が速いことがわかる。

図 6、7 には放電洗浄前後におけるプラズマ電 流波形と周回電圧波形の比較を示す。このときの トカマク放電電圧は5kV、水素ガス圧力2.25× 10⁻⁴ Torrである。放電洗浄後には、プラズマ電流 の最高値は直流グローの場合1.2倍、パルスグロ ーの場合1.9倍になり、パルス幅の長いプラズマ 電流波形が得られた。但し、パルスグロー放電洗 浄前のプラズマ電流は直流の場合に比べ、最大値 が小さい。これは真空漏れにより水素の純度が下 がったためである。しかしながら、洗浄後のプラ ズマ電流の最大値は直流の場合よりも大きくな った。これにより、直流グローとパルスグローに よる放電洗浄効果を比較すると、パルスグローの 方が定量的には洗浄効果が大きいことが示され た。この理由としては、パルスグローの電流のピ ーク値が大きいことが効いていると考えられる。

4. プラズマの位置特性

まず、プラズマの大半径方向の平衡のために必 要な外部から加える垂直磁場は次式で表される。

$$B_{\rm Z} = -\frac{\mu_0 I_{\rm p}}{4\pi R} \left(\ln \frac{8R}{a} + \frac{l_{\rm i}}{2} - \frac{3}{2} + \beta_{\rm p} \right)$$

 I_p : プラズマ電流、R: プラズマ大半径

 A:内部インダクタンス、a:プラズマ小半径 p:プラズマ圧力とポロイダル磁場圧力の比 この式より、等々力2号においてプラズマ電流5 kAのとき50Gの垂直磁場が必要と評価される。
本装置では、垂直磁場コイル電源150 Vのとき に50Gの垂直磁場を発生することができる。

次に、フォトダイオードアレイを用いた発光分 布検出器について以下に述べる。プラズマはリミ タ半径内に生成されるので、図8に示すように フォトダイオードアレイをポート内に取り付け る必要がある。そのため、図8中の赤線で示す 石英窓付きのパイプを各ポートに取り付け、その 中にフォトダイオードを設置した。垂直ポートに 設置したものから大半径方向の位置を、水平ポー トに設置したものから垂直方向の位置を計測す る。図9には計測で使用したチャンネルを示す。 大半径方向、垂直方向ともに中心位置に対して対 称に選んで計測を行った。また、フォトダイオー ドの分光感度を図10に示す。本研究では全波長 領域で計測を行っているが、フィルタを用いれば 分光計測も可能である。



図8 フォトダイオードアレイ設置概要



図 10 Si フォトダイオードの分光感度特性

図 11 にプラズマ電流とプラズマ光の波形を示 す。プラズマ光波形はピークの前後で振動してい る。この振動はチャンネルによって時間的にずれ ており、またロゴスキーコイルの出力結果と比較 するとほぼ同期していることから、プラズマの不 安定性によるものだと考えられる。

図 12 に垂直磁場を印加していない場合の 0.1 ms 毎のプラズマ光強度の空間分布を示す。大半 径方向に対して、プラズマ電流のピーク前後では トーラス外側に拡がっている。それ以降は、真空 容器中心位置に留まってプラズマは消えている。 また、垂直方向に対しては、ほぼ赤道面位置に平 衡がとれている。図 13 に垂直磁場を印加した場 合のプラズマ電流、垂直磁場コイル電流波形を、 図 14 に 0.1 ms 毎のプラズマ光強度の空間分布



図 11 プラズマ電流及びプラズマ光の波形



図 12 垂直磁場を印加しない場合の プラズマ光強度の空間分布の時間変化

を示す。このときの垂直磁場コイル電源のコンデ ンサ充電電圧は150 V で、2.0 ms の時刻に垂直 磁場を印加している。垂直磁場を印加したことに より、プラズマ電流のピーク前後において大半径 方向に対して真空容器中心位置にプラズマの平 衡がとれた。しかし、その時間を過ぎると、プラ ズマが外に拡がろうとする力よりも垂直磁場に よる力が強くなる。それゆえに、プラズマは内側 ヘシフトしている。また、垂直方向に対しては垂 直磁場によりわずかに下側へ押されているが、プ ラズマは赤道面付近に平衡がとれている。また、 垂直磁場の強さによるプラズマ位置特性への影 響について調べた。垂直磁場が強くなると、プラ



図 13 プラズマ電流、垂直磁場コイル電流波形



図 14 垂直磁場を印加した場合の プラズマ光強度の空間分布の時間変化

ズマが外に拡がろうとする力よりも強くなり、プ ラズマは大半径方向では内側に押されてしまう ことを確かめた。また、垂直磁場の印加タイミン グを遅らせると、2.2 ms まではプラズマは内側 に押されてしまうが、2.3 ms になると、垂直磁 場の効果が弱くなり、プラズマは外側に拡がるこ とが明らかになった。

5. まとめ

グロー放電洗浄を行ったことにより、洗浄後の プラズマ電流は最大値が増加し、パルス幅の長い 波形が得られた。また、直流グローとパルスグロ ーによる放電洗浄の比較を行い、パルスグルーの 方が洗浄効果が大きいことが明らかになった。

プラズマ発光分布計測によりプラズマの位置 特性について調べ、ビリアル限界コイルを用いた トカマク装置においてプラズマの位置制御性に 問題がないことを実証した。

6. 今後の課題

フィードバック制御が可能な垂直磁場コイル 電源の製作を行い、プラズマの水平位置制御を行 う。